## Энергетические потоки и радиационные эффекты

УДК 537.525, 621.785.5

DOI: 10.17223/00213411/65/11/38

## ОСОБЕННОСТИ АЗОТИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕЛКОМОДУЛЬНОГО ЗУБЧАТОГО ВЕНЦА В ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКОМ ГАЗОВОМ ПУЧКОВО-ПЛАЗМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ\*

В.В. Денисов $^1$ , Ю.А. Денисов $^1$ , Е.В. Островерхов $^1$ , А.В. Леканов $^2$ , А.А. Леонов $^1$ , Н.Н. Коваль $^1$ , Р.А. Садриев $^2$ , В.Н. Тищенко $^1$ , Е.А. Улыбушев $^2$ , Д.А. Черепанов $^2$ 

 $^1$ Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск, Россия  $^2$  АО «Информационные спутниковые системы» им. акад. М.Ф. Решетнёва», г. Железногорск, Россия

Представлены результаты исследования однородности толщины модифицированного слоя на поверхности зубчатого венца из конструкционной стали 38X2MOA с модулем зуба m=0.5 и количеством зубов 14, полученного в результате ионно-плазменного азотирования в пучково-плазменном образовании, генерируемом в стационарном и импульсно-периодическом несамостоятельном тлеющем разряде с полым катодом при низком, около 1 Па, давлении. Проведено сравнение толщин азотированного слоя на вершине и в основании зуба, полученных при коэффициенте заполнения разрядного импульса  $\gamma=100$ , 85 и 50%. Показано, что минимальная разница в толщинах азотированного слоя, составляющая около 6%, характерна для режима с коэффициентом заполнения разрядного импульса  $\gamma=85\%$ . Газовые пучково-плазменные образования, формируемые при низком давлении, перспективны в процессах ионно-плазменного азотирования деталей сложной формы.

**Ключевые слова:** пучково-плазменное образование, низкое давление, ионно-плазменное азотирование, тлеющий разряд, полый катод, конструкционная сталь, мелкомодульный зубчатый венец.

## Введение

Эффективным инструментом для решения широкого круга исследовательских и производственных задач является низкотемпературная плазма, генерируемая в различных типах разрядов, в частности в разрядах низкого ( $\approx 1$  Па) давления [1]. Значительный интерес представляют вопросы использования объемных газовых, металлических и газо-металлических плазменных образований, формируемых в разрядах низкого давления для упрочнения поверхности материалов и изделий [2–4]. Техника развивается в направлении создания оборудования с рядом таких улучшенных характеристик, как повышенные ( $> 0.1 \text{ м}^3$ ) объемы формируемых плазменных образований, высокая степень однородности, широкий диапазон изменения условий генерации и независимое управление ими. Газовые пучково-плазменные образования, генерируемые в газоразрядных системах, характеризуются высокой однородностью формируемой плазмы по объему вакуумной камеры [5].

Благодаря возможности независимой регулировки напряжения горения разряда, начиная от нескольких десятков вольт и до нескольких киловольт, рабочего давления в диапазоне  $5 \cdot 10^{-3} - 1$  Па [6], состава газовой смеси, тока тлеющего разряда за счет изменения тока инжектированных электронов из плазмы вспомогательного разряда концентрация ионов в пучково-плазменных образованиях может плавно регулироваться в широчайшем диапазоне  $10^9 - 10^{12}$  см<sup>-3</sup>. При низком  $(\approx 10^{-2}-1\ \Pi a)$  давлении вероятность столкновения ионов, ускоренных в слое прикатодного падения потенциала или слое падения потенциала смещения обрабатываемой подложки, с частицами газа очень мала [7]. Благодаря этому плавным изменением величины отрицательного (относительно потенциала анода) потенциала смещения можно плавно изменять энергию бомбардирующих ионов, оценивая с высокой, до нескольких процентов, точностью абсолютную величину энергии ионов. Другой важной особенностью пучково-плазменных образований при концентрациях плазмы  $\approx 10^{12}~{\rm cm}^{-3}$  является малая ширина слоя прикатодного падения потенциала – доли – единицы миллиметра. Благодаря этому становится возможной эффективная обработка поверхности изделий сложной геометрии и формы, например, деталей мелкомодульных зубчатых передач, используемых в различных приводах и механизмах поворота ответственных узлов. Однако достижение таких высоких значений концентрации плазмы в постоянном режиме горения разряда нецелесообразно ввиду высокой вероятности достижения обрабатываемым изделием неприемлемо высоких температур. Использование импульсно-периодического режима формирования плазмы с регули-

\_

<sup>\*</sup> Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по теме № FWRM-2022-0001.

## Уважаемые читатели!

Доступ к полнотекстовой версии журнала «Известия высших учебных заведений. Физика» осуществляется на платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU на платной основе:

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7725